

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成22年8月26日(2010.8.26)

【公開番号】特開2009-62604(P2009-62604A)

【公開日】平成21年3月26日(2009.3.26)

【年通号数】公開・登録公報2009-012

【出願番号】特願2007-233724(P2007-233724)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/56 (2006.01)

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 L 21/285 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/56 G

H 0 1 L 21/68 A

C 2 3 C 16/44 F

H 0 1 L 21/88 R

H 0 1 L 21/285 C

H 0 1 L 21/285 S

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月8日(2010.7.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記第1の処理チャンバはPVD処理を行うPVD処理チャンバであり、前記第2の処理チャンバはCVD処理を行うCVD処理チャンバであることを特徴とする請求項1に記載の真空処理システム。